

სილიციუმ-გერმანიუმის შენადნობის თერმოელექტრული მახასიათებლების დამოკიდებულება მასალის განზოგადოებულ პარამეტრსა და ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორზე

რაფიელ თხინვალი,¹ ზურაბ ადამია,^{2,3} ლაშა ლორია,⁴ ირაკლი ნახუცრიშვილი¹

¹საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი; ²სოხუმის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტი ³საქართველოს უნივერსიტეტი; ⁴თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რეზიუმე

განხილულია სილიციუმ-გერმანიუმის შენადნობის განზოგადოებული პარამეტრი B^* . შესწავლილია მასალის ფაზური შემადგენლობის ($\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$, $x=0.7, 0.72, 0.76, 0.8$ და 0.83) გავლენა აღნიშნულ პარამეტრზე ოთახის ტემპერატურასთან მიხლოვებულ პირობებში. ასევე აგებულია დამოკიდებულება ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორსა და განზოგადოებულ პარამეტრს შორის. მიღებულია ფორმულა, რომელიც პირდაპირ აკავშირებს მასალის განზოგადოებულ პარამეტრს ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორთან $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ -ის მოცემული შემადგენლობისათვის.

საკვანძო სიტყვები: $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ შენადნობი, თერმოელექტრული მასალის განზოგადოებული პარამეტრი, ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორი.

შესავალი

თერმოელექტრული მასალებით ხორციელდება პირდაპირი კონვერტაცია სითბურ და ელექტრულ ენერგიებს შორის. ამ მასალების ძირითადი მახასიათებელია თერმოელექტრული ვარგისიანობის ფაქტორი $ZT = S^2\sigma T/\kappa$, სადაც S , T , σ და κ შესაბამისად ზეებევის კოეფიციენტი, აბსოლუტური ტემპერატურა, ხვედრითი ელექტროგამტარობა და სითბოგამტარობის კოეფიციენტი.

ბოლო ათწლეულში შემუშავებულ იქნა ახალი მიდგომები ტრადიციული ZT -ს დასახასიათებლად. კერძოდ შემოღებულ იქნა ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორისა (B_E) და თერმოელექტრული მასალის განზოგადოებული პარამეტრის (B^*)⁽¹⁾ ცნებები [1,2]. ეს უკანასკნელი მოიცემა ფორმულით:

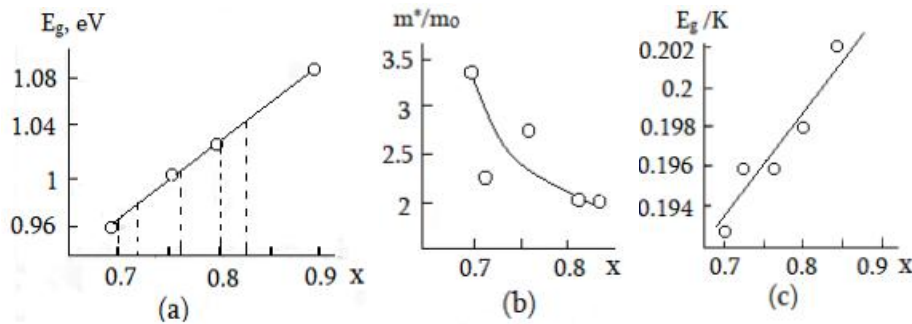
$$B^* = 6.668 \cdot 10^{-2} \frac{U^*}{k} E_g, \quad (1)$$

სადაც $U^* = \mu(Tm^*/m_0)^{3/2}$ (μ და m^* - მუხტის მატარებელთა ძვრადობა და ეფექტური მასა, m_0 - ელექტრონის უძრაობის მასა, E_g - აკრძალული ზონის სიგანე). B^* -ში ურთიერთდაკავშირებულია ეს სამი ფუნდამენტური პარამეტრი (U^* , k , და E_g), რომლებიც მოქმედებენ ZT-ზე.

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია სილიციუმ-გერმანიუმის შენადნობის B^* , B_E და ZT პარამეტრები (ეს შენადნობი ფართოდ გამოიყენება მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგში, მათ შორის თერმოელექტრობაში). კერძოდ, შესწავლილია ფაზური შემადგენლობის (Si_xGe_{1-x} , $x=0.7, 0.72, 0.76, 0.8$ და 0.83) გავლენა აღნიშნულ პარამეტრებზე $(300-306)^\circ K$ ტემპერატურებზე. გამოთვლილია აგრეთვე ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორი B_E და ზოგიერთი სხვა თერმოელექტრული მახასიათებელი.

მეთოდოლოგია

საკვლევი მასალის დოპირება ხდებოდა ფოსფორით N-ტიპის გამტარებლობის მისაღებად; მუხტის მატარებელთა კონცენტრაცია შეადგენდა $n=3.2 \cdot 10^{26} \text{მ}^{-3}$ -ს; ძვრადობა და თბოგამტარობის კოეფიციენტი განისაზღვრებოდა ექსპერიმენტალურად; ეფექტური მასები კი გამოითვლებოდა თეორიულად (იხ. დამატება და ნახ.5ბ); აკრძალული ზონის სიგანის სიდიდის განსაზღვრელად გამოვიყენეთ ნაშრომ [3]-ში მოყვანილი $E_g - x$ დამოკიდებულება (ნახ.1), საიდანაც ვახდენდით ექსტრაპოლაციას x -ის საკვლევი მნიშვნელობებისაკენ. E_g -ს ზრდა მასალაში გერმანიუმის შემცველობის შემცირებით შეიძლება აიხსნას გერმანიუმის ატომის ელექტრონულ კონფიგურაციაში შევსებული $3d^{10}$ გარსის გავლენით.

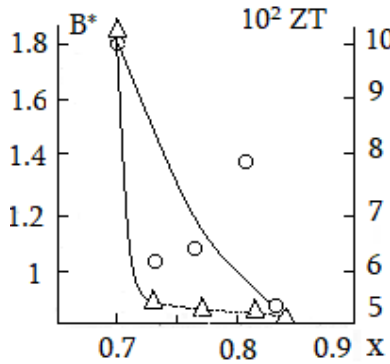


ნახ.1. (a) $E_g - x$ დამოკიდებულება ოთახის ტემპერატურისათვის [3], (b) $m^*/m_0 - x$ და (c) $E_g/k - x$ დამოკიდებულებები იმავე ტემპერატურაზე.

შედეგების განხილვა

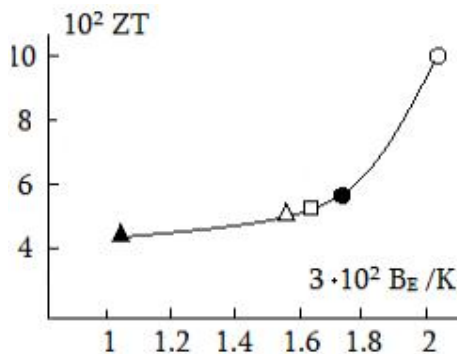
ნახ.2-ზე მოყვანილია $B^* - x$ და $ZT - x$ დამოკიდებულებები Si_xGe_{1-x} -სათვის. ნახაზზე ნაჩვენებმა ZT-ს სიდიდეებმა ($\sim 0.05-0.1$) არ უნდა გვაფიქრებინოს, რომ SiGe შენადნობი დაბალი

თერმოელექტრული ვარგისიანობისა: ამ მასალისათვის ZT აღწევს ~0.6-ს P-ტიპის ნიმუშებისათვის და ~0.8-ს N-ტიპისათვის, რაც დაახლოებით 940°C-ზე იჩენს თავს [4,5].



ნახ.2. B* - x (○) და ZT - x (Δ) დამოკიდებულებები.

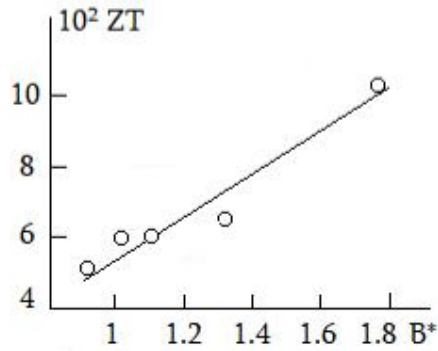
ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორი მოიცემა გამოსახულებით $B_E = \sigma S^2 / B_S$, სადაც $B_S = S_r \left[\frac{S_r e^{(2-S_r)}}{1+e^{-5(S_r-1)}} + \frac{\pi^2}{3[1+e^{5(S_r-1)}]} \right]$ არის სიმძლავრის მასშტაბირებული ფაქტორი, ხოლო S_r - ზეებეკის დაყვანილი კოეფიციენტი: $S = (q_e / k_B) S \approx 1.16 \cdot 10^4 S$ (q_e - ელემენტარული მუხტი, k_B - ბოლცმანის მუდმივა). [1]-ში მოყვანილია ოთახის ტემპერატურაზე ZT-ს მაქსიმალური სიდიდის დამოკიდებულება კომბინაცია $B_E T / k$ -ზე სხვადასხვა თერმოელექტრიკული მასალისათვის. ნახ.3-ზე წარმოდგენილია ჩვენი მონაცემები, გამოთვლილი $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ -ის ყველა საკვლევი შემადგენლობისათვის.



ნახ.3. ZT - $300 B_E / k$ დამოკიდებულებები $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ -სათვის: $x=0.7$ (○), 0.72 (Δ), 0.76 (□), 0.8 (●) და 0.83 (▲).

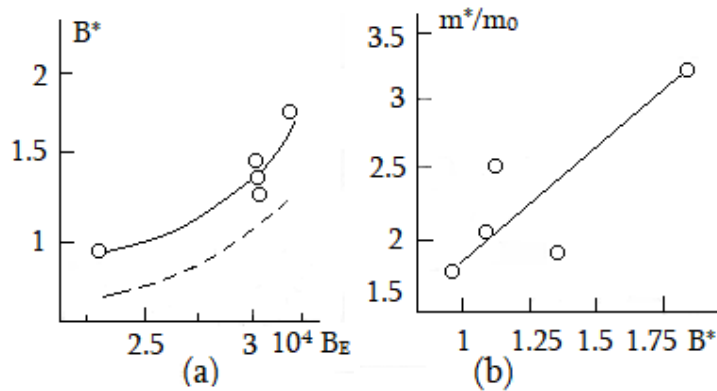
აქაც უნდა გავიმეოროთ, რომ ZT-ს მოყვანილი მნიშვნელობები არ წარმოადგენს ამ პარამეტრის მაქსიმალურ სიდიდეებს. პირიქით: ეს მნიშვნელობები ყველაზე უფრო მცირეა ცალკეული ნიმუშისათვის ტემპერატურის საკვლევ ინტერვალში.

ნახ.4-ზე მოყვანილია დამოკიდებულება ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორსა და განზოგადოებულ პარამეტრს შორის. როგორც ნახაზიდან ჩანს, იგი პრაქტიკულად წრფივია. ZT - B^* დამოკიდებულების წრფივობა ნაჩვენებია [2]-ში ცვლადების უფრო მაღალი მნიშვნელობებისათვის.



ნახ.4. ZT- B* დამოკიდებულება.

ბოლოს მოვიყვანოთ დამოკიდებულება უშუალოდ მასალის განზოგადოებულ პარამეტრსა და ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორს შორის (ნახ.5).



ნახ.5. (a) B* - B_E და (b) m*/m₀ - B* დამოკიდებულებები. წყვეტილი ხაზი - ფორმულა (2)-ის მიხედვით.

ამ პარამეტრთა გამოსახულებების კომბინაციათა მარტივი გარდაქმნით მივიღებთ: $B^* \cong 1.544 \cdot 10^4 E_g B_E / k$, რაც ნიშნავს იმას, რომ

$B^* \cong (0.088x + 0.238) \cdot 10^4 B_E$ (2) (იხ. სტრიქონსქედა შენიშვნა⁽²⁾). ეს ფორმულა მოსახერხებელია იმ თვალსაზრისით, რომ პირდაპირ აკავშირებს მასალის განზოგადოებულ პარამეტრს ელექტრონული ვარგისიანობის ფაქტორთან Si_xGe_{1-x}-ის მოცემული შემადგენლობისათვის.

დამატება

მუხტის მატარებელთა ეფექტური მასების გამისათვლელად გამოვიყენეთ შემდეგი ფორმულა [6]:

$$\frac{m^*}{m_0} \cong 1.059 \cdot 10^{-15} \left(\frac{n^{2/3}}{T} \right) \left\{ \frac{3[e^{(S_r-2)} - 0.17]^{2/3}}{1 + e^{-5(S_r - S_r^{-1})}} + \frac{S_r}{1 + e^{5(S_r - S_r^{-1})}} \right\} \cong \frac{6.608 \cdot 10^{-15}}{T} [ne^{(S_r-2)}]^{2/3}. \quad (3)$$

კონცენტრაციისა და ტემპერატურის სიდიდეთა გათვალისწინებით განტოლება (3) მიიღებს სახეს: $m^*/m_0 \cong 0.816(e^{S_r-2})^{2/3}$ (იხ. ნახ.1b-ზე მოყვანილი m*/m₀ - x დამოკიდებულება).

სტრიქონსქვედა შენიშვნები:

⁽¹⁾ ამ სიდიდეს უწოდებენ აგრეთვე ვარგისიანობის (პირველად) ეფექტურ პარამეტრს.

⁽²⁾ $E_g/k - x$ დამოკიდებულების წრფივობიდან (ნახ.1c) გამოდის, რომ $E_g/k \cong 0.057x + 0.154$.

დასკვნა

განხილულია სილიციუმ-გერმანიუმის შენადნობის (Si_xGe_{1-x} , $x=0.7, 0.72, 0.76, 0.8$ და 0.83) B^* , B_E და ZT პარამეტრები. გაანალიზებულია $E_g - x$, $B^* - x$, $ZT - x$, $m^*/m_0 - x$, $B_E - B^*$ და $m^*/m_0 - B^*$ დამოკიდებულებები.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. X.Zhang, Z.Bu et al. Electronic quality factor for thermoelectrics. Science Advances, 2020, 6, eabc0726.
2. W.Liu, J.Zhou et al. New insight into the material parameter B to understand the enhanced thermoelectric performance of $Mg_2Sn_{1-x-y}Ge_xSb_y$. Energy Environm. Sci., 2016, 9, 530-539.
3. A.M.Al-sheikh, M.M.Hussien, S.J.Abdullah. Pressure and temperature dependence of energy gap in SiC and $Si_{1-x}Ge_x$. Raf. Sci., 2019, 28, 53-61.
4. G.Bokuchava, K.Barbakhadze, I.Nakhutsrishvili. Thermoelectric parameters of alloy p-Si_{0.7}Ge_{0.3}. Bull. Georg. Acad. Sci., 2023, 17, 33-37.
5. G.Bokuchava, K.Barbakadze, I.Nakhutsrishvili. On the thermoelectric alloy n-Si_xGe_{1-x}. Material Sci. & Engin., 2023, 7, 54-57.
6. G.J.Snyder, A.Pereyra, R.Gurunathan. Effective mass from Seebeck coefficient. Adv. Funct. Materials. 2022, 32, 2112772.

Dependence of the Thermoelectric Characteristics of the Silicon-Germanium Alloy on the Generalized Parameter of the Material and Electronic Quality Factor

Rafiel Tkhinvaleli,¹ Zurab Adamia,^{2,3} Lasha Loria,² Irakli Nakhutsrishvili¹

¹Institute of Cybernetics of Georgian Technical University; ²Sukhumi Institute of Physics and Technology;

³University of Georgia; ⁴Tbilisi State University

Summary

The generalized parameter B^* of silicon-germanium alloy is discussed. The influence of the phase composition of the material ($\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$, $x=0.7, 0.72, 0.76, 0.8$ and 0.83) on the mentioned parameter under conditions close to room temperature has been studied. The relationship between the electronic quality factor and the generalized parameter is also constructed. A formula has been obtained ($B^* \cong (0.088x + 0.238) \cdot 10^4 B_E$) that directly relates the generalized material parameter to the electronic correspondence coefficient for a given composition of $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$.

Keywords: $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ alloy, generalized parameter of thermoelectric material, electronic quality factor.